

Рис. 3.

При исследовании характеристик метода модуляции пространственно-энергетических параметров электронного луча рассматривались два режима записи: изменение интенсивности регистрирующего луча и диаметра сфокусированного на носителе электронного пятна. В обоих режимах в соответствии с входным сигналом изменялась величина нагрева ферромагнитного слоя ленты. Вследствие наличия для хромдиоксидной пленки температурной зависимости остаточной намагниченности [3] на носителе регистрируются соответственно различные значения постоянного поля магнитной головки. На рис. 3 представлены модуляционные характеристики записи для режима изменения тока луча. Относительная погрешность измерений составляет 10%. Аналогичный вид имеют и характеристики для режима изменения диаметра электронного луча.

Основной недостаток последнего метода — изменение в соответствии с амплитудой регистрируемого сигнала размера элемента записи. Это приводит в отдельных случаях с учетом частотных характеристик ленты и магнитооптического кристалла к снижению динамического диапазона визуализации.

Одним из путей оптимизации параметров устройств ЭЛТМЗ может быть комбинация в требуемой форме описанных основных методов. Однако этот путь малоперспективен, так как приводит к существенному усложнению отдельных узлов устройств и электронных схем обеспечения.

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что наиболее целесообразным методом электронно-лучевой термомагнитной регистрации информации является запись модулиацией поля магнитной головки. При использовании такого способа регистрации получена запись сигналов в полосе частот 6,5 МГц с динамическим диапазоном в элементе разрешения 35 дБ.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Дереновский М. В., Лысак В. В., Шмарев Е. К. Электронно-лучевая термомагнитная запись. — ЖТФ, 1984, т. 54, вып. 6, с. 1189.
2. Дереновский М. В., Лысак В. В., Шмарев Е. К. Магнитооптический пространственно-временной модулятор света. — Автометрия, 1985, № 2, с. 81.
3. Waring R. K. Cr—O<sub>2</sub>-based thermomagnetic information storage and retrieval systems. — J. Appl. Phys., 1971, v. 42, N 4, p. 887.

Поступило в редакцию 22 июля 1985 г.

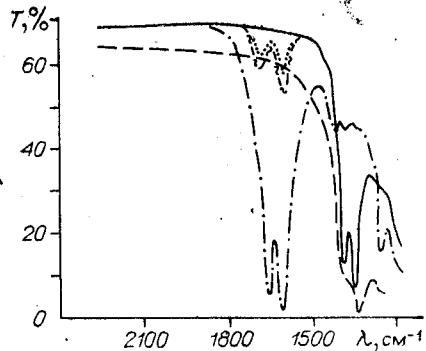
УДК 535.343.2 : 621.3.037.732

В. А. ГУСЕВ, С. И. ДЕМЕНКО  
(Новосибирск)

#### ПРОПУСКАНИЕ СИЛЛЕНИТОВ В ИНФРАКРАСНОЙ ОБЛАСТИ СПЕКТРА

Силико-, германо- и титаносиллениты являются пьезоэлектриками, обладают электрооптическим эффектом, имеют хорошую фоточувствительность в сине-зеленой области спектра [1]. Используя их в качестве активных элементов, можно изготавливать пространственно-временные модуляторы света типа ПРОМ и ПРИЗ [2]. В этих материалах обнаружено явление стимулированного полем электрохимического вос-

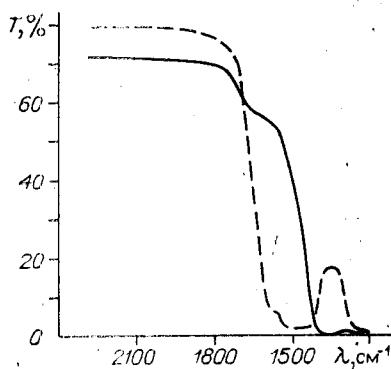
*Рис. 1. Инфракрасные спектры пропускания силленитов:*  
 $\text{Bi}_{12}\text{SiO}_{20}$  (штрихпунктирная кривая);  $\text{Bi}_{12}\text{TiO}_{20}$  (штриховая кривая);  $\text{Bi}_{12}\text{GeO}_{20}$  (сплошная кривая);  $\text{Bi}_{12}\text{GeO}_{20} : \text{Si}$  (начало були);  $\text{Bi}_{12}\text{GeO}_{20} : \text{Si}$  (конец були) (точечная кривая).



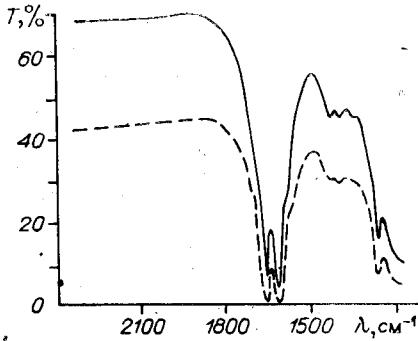
становления висмута, которое используется для записи, хранения, обработки информации и неразрушающего считывания как в видимой, так и в инфракрасной области спектра [3].

В данном сообщении приведены результаты исследования ИК-поглощения монокристаллов силленитов. Изучались образцы  $\text{Bi}_{12}\text{SiO}_{20}$  (BSO),  $\text{Bi}_{12}\text{GeO}_{20}$  (BGO),  $\text{Bi}_{12}\text{TiO}_{20}$  (BTO),  $\text{Bi}_4\text{Zr}_3\text{O}_{12}$ , выращенные методом Чохральского, специально легированные, а также легированные алюминием и кремнием (BGO : Al, Si). Измерялись спектры пропускания при  $T = 300$  К в области  $1200-2400$   $\text{cm}^{-1}$  на спектрофотометре ИКС-29. На рис. 1 представлены спектры пропускания BGO, BSO, BTO и  $\text{BGO} : \text{Si}$ . У BGO, BSO и BTO, одинаковых по кристаллографическому строению и близких по физическим свойствам, качественное подобие формы ИК-спектров позволяет предполагать, что спектры в основном обусловлены поглощением света на колебаниях решетки. В области спектра от  $1200$  до  $1700$   $\text{cm}^{-1}$  наблюдается двухфотонное поглощение, а в области от  $1700$  до  $2400$   $\text{cm}^{-1}$  — многофотонное поглощение [4]. Как видно из рисунка, в области двухфотонного поглощения на спектрах пропускания BSO проявляются пики поглощения при  $1614$  и  $1657$   $\text{cm}^{-1}$ , а на спектрах пропускания BGO — при  $1353$  и  $1388$   $\text{cm}^{-1}$ , которые авторы [4] связывают с атомами четвертой группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева. На спектрах пропускания BGO : Si отчетливо видны пики поглощения при  $1614$  и  $1657$   $\text{cm}^{-1}$  (см. рис. 1).

Можно предположить, что при легировании германата кремний занимает в решетке места германия, степень заполнения которых равна 0,9 [5], и образует «островки» BSO в кристаллической матрице BGO. Результаты количественного спектрального анализа показывают, что у BGO с добавкой  $\text{SiO}_2$  в шихту в начале були содержание кремния больше, чем в конце, что и проявляется на спектрах пропускания. Как известно, легирование алюминием существенным образом меняет свойства силленитов: уменьшает поглощение и фоточувствительность в видимой области спектра, а при больших концентрациях легирующей добавки ( $> 0,1$  вес. %) меняется и тип проводимости [6]. В ИК-области спектра пропускания BGO : Al изменяется: область однофотонного поглощения начинает проявляться значительно раньше (примерно от  $1400$   $\text{cm}^{-1}$ ), а в области двухфотонного поглощения в пропускании появляется «полочка». Спектр пропускания BGO : Al качественно напоминает спектр эвлитина (рис. 2). Можно предположить, что силлениты при леги-



*Рис. 2. Инфракрасные спектры пропускания:*  
 $\text{Bi}_{12}\text{GeO}_{20} : \text{Al}$  (сплошная кривая);  
 $\text{Bi}_4\text{Zr}_3\text{O}_{12}$  (штриховая кривая).



*Рис. 3. Инфракрасные спектры пропускания:*  
 $\text{Bi}_{12}\text{SiO}_{20}$  (сплошная кривая);  $\text{Bi}_{12}\text{SiO}_{20}$  с поверхностью пленкой висмута, выделившейся в процессе амплитудной записи (штриховая кривая).

ровании алюминием меняют класс симметрии и постоянную решетки, при этом сначала блоками, а затем полностью в кристалле образуется новая фаза, близкая по своей структуре к эвлитинам, что вполне вероятно, так как силлениты имеют узкую зону гомогенности и очень чувствительны к стехиометрии состава.

Как отмечалось выше, в силленитах при амплитудной записи оптической информации наблюдается выделение пленки металлического висмута на поверхности. Этот процесс не затрагивает объем кристалла, а происходит в приповерхностном слое, поэтому положение пиков поглощения в ИК-области спектра не меняется, а лишь увеличивается общее поглощение, обусловленное металлической пленкой (рис. 3). При удалении пленки механическим способом (полировкой поверхности) спектр пропускания кристалла восстанавливается.

В заключение авторы считают своим приятным долгом выразить благодарность В. П. Котенко и В. К. Малиновскому за внимание к работе и ценные замечания.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Бережной А. А., Гуревич В. З., Попов Ю. В. Перспективы применения некоторых электрооптических кристаллов для пространственно-временной модуляции света.— Опт. и спектр., 1977, т. 42, вып. 5, с. 981—987.
2. Петров М. И., Хоменко А. В., Марахонов В. И., Шлягин М. Г. Исследование физических процессов записи и дифракции света в слоистых структурах на основе электрооптических кристаллов.— В кн.: Оптическая обработка информации. Л.: ФТИ им. А. Ф. Иоффе, 1979, с. 143—154.
3. Гудаев О. А., Гусев В. А., Деменюк С. И., Малиновский В. К. Стимулированное полем восстановление висмута в силленитах ( $\text{Bi}_{12}\text{SiO}_{20}$  и  $\text{Bi}_{12}\text{GeO}_{20}$ ).— ФТТ, 1985, т. 27, вып. 9, с. 2786—2789.
4. Бабонас Г., Зарецкий Ю. Г., Леонов Е. И. и др. Инфракрасные спектры поглощения монокристаллов  $\text{Bi}_{12}\text{SiO}_{20}$  и  $\text{Bi}_{12}\text{GeO}_{20}$ .— Лит. физ. сб., 1981, т. XXI, № 3, с. 59—63.
5. Abrahams S. C., Jamiecon P. B., Bernstein I. L. Crystal structure of piezoelectrical bismuth germanium oxide  $\text{Bi}_{12}\text{GeO}_{20}$ .— J. Chem. Phys., 1967, v. 47, N 10, p. 4034—4041.
6. Hou S. L., Lauer R. B., Aldrich R. E. Transport processes of photoinduced carriers in  $\text{Bi}_{12}\text{SiO}_{20}$ .— J. Appl. Phys., 1973, v. 44, N 6, p. 2652—2658.

Поступило в редакцию 17 сентября 1985 г.

УДК 666.117.9

А. А. АНИКИН, А. А. СОКОЛОВ  
(Новосибирск)

## МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ СТЕКЛА ФХС-4 В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ОСВЕЩЕНИЯ

**Введение.** При рассмотрении возможности применения фотохромных стекол для решения тех или иных задач всегда приходится задаваться вопросом: как меняются окраска стекла в конкретных условиях? В наиболее простом и общем виде задача формулируется следующим образом: с какой скоростью и до какого уровня потемнеет стекло при освещении его светом определенного спектрального состава и интенсивности, как будет меняться во времени его прозрачность после прекращения облучения? В настоящее время в каждом конкретном случае возникает необходимость проведения ряда соответствующих экспериментов. В этой связи очевидна актуальность разработки методов описания свойств фотохромных стекол, позволяющих на основе небольшого числа измерений прогнозировать их поведение в самых разнообразных ситуациях. Задача эта непростая. При облучении фотохромного стекла происходят одновременно три процесса: образование фотолитического серебра, его термический распад и световое разрушение. Кроме того, во время экспонирования в глубине стекла уменьшается интенсивность света и меняется его спектральный состав: предыдущие слои работают как фильтр с переменным светопропусканием.

Известные к настоящему времени физические модели фотохромных процессов недостаточно развиты для более или менее достоверного описания с их помощью процессов окрашивания и обесцвечивания. Определенные попытки в этом направлении предпринимались в [1—3] в рамках оболочечной модели центров окраски. Однако как сама оболочечная модель, так и предположения, положенные в основу построения кинетических уравнений, весьма спорны.

В настоящей работе используется другой подход: экспериментально выявляются основные закономерности фотохромных процессов и на этой основе разрабатывается способ описания свойств фотохромных стекол.

**Методика.** Все измерения и расчеты проводились для фотохромного стекла